

Photolithographie



Préparation de surface

- Etuve HMDS - hexaméthylsilazane (promoteur d'adhérence)
- Etuve - évaporation de solvant et séchage

Application de la résine photosensible

- Equipements d'enduction de résine manuelle et automatisée
- Equipement de dépôt résine par spray : Coater spray (Alta spray) SUSS
- Lamineuse pour film sec photosensible

Exposition

- Aligneurs de masque - SUSS Microtec
- Aligneurs de masque double face - EVG (avec option lithographie par nano-impression - UV-NIL (UltraViolet NanoImprint Lithography))
- Lithographie laser OPTEC

Développement et retrait résine

- Développeurs aqueux et solvant - Optiwet
- Equipement de retrait résine par plasma O₂



- Equipement de lithographie à faisceaux d'électrons (E-beam)

